СЕНСОЭЛЕКТРОНИКА. ДАТЧИКИ

Д. т. н. А. А. ДРУЖИНИН, к. ф.-м. н. И. П. ОСТРОВСКИЙ, С. М. МАТВИЕНКО, Ю. Р. КОГУТ

Украина, Национальный университет «Львовская политехника» E-mail: druzh@polynet.lviv.ua

Дата поступления в редакцию 15.06 2004 г.

Оппоненты к. ф.-м. н. В. В. КОВАЛЬЧУК (ЮГПУ им. К. Д. Ушинского, г. Одесса), А. И. КОНДРИК (Харьковскй физ.-техн. ин-т)

ДАТЧИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КРИОГЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР НА ОСНОВЕ НИТЕВИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ Si–Ge

На основе сильнолегированных нитевидных кристаллов Si—Ge создан датчик для измерения криогенных температур, работоспособный в условиях магнитных полей.

Исследование эффекта Зеебека в сильнолегированных кристаллах при низких температурах представляет интерес как с физической точки зрения (изучение таких явлений как прыжковая проводимость, фононное увлечение носителей заряда [1, 2]), так и с прикладной (например, для создания сенсоров температуры [3]). В [4] исследовалось поведение термоэдс в сильнолегированных нитевидных кристаллах (НК) Si–Ge в температурном интервале 4,2—300 К под воздействием одноосной деформации. Однако основное внимание в этой работе уделялось изучению природы деформационно-стимулированных эффектов в НК твердого раствора $Si_{1-x}Ge_x$ (x=0,01...0,05).

В настоящей работе проведены исследования терморезистивных и термоэлектрических характеристик нитевидных кристаллов твердых растворов $Si_{1-x}Ge_x$ (x=0,01...0,05) в температурном интервале 4,2—200 К с целью создания сенсоров криогенных температур на их основе, работоспособных в условиях действия магнитных полей.

Нитевидные кристаллы твердого раствора SiGe выращивали методом химических транспортных реакций в закрытой бромидной системе с использованием золота как инициатора роста. Температура зоны источника составляла 1250° С, зоны роста — 900° С. Состав твердого раствора Si_{1-x} Ge_x определялся методом микрозондового анализа. Кристаллы имели диаметр 40—50 мкм и длину 10—12 мм.

Полученные НК с платиновыми контактами приклеивали с помощью клея ВЛ-931 на подложки с отличным от Si–Ge температурным коэффициентом расширения (ТКР), после чего охлаждали до криогенных температур. За счет различия ТКР подложки и кристаллов возникала их деформация. Степень деформации (ϵ) зависела от материала подложек и изменялась от $-4,3\cdot10^{-3}$ до $1,4\cdot10^{-3}$ отн. ед.

Коэффициент Зеебека измерялся по четырехконтактной схеме (**рис. 1**) в температурном интервале 4,2—200 К. При этом контакты *1* и *2* использовали как ветвь разогрева (терморезистивную ветвь), создающую градиент температуры между контактами *3*



Рис. 1. Схема измерения термо-эдс

и 4, на которых измерялась термо-эдс (термоэлектрическая ветвь). Расстояние между контактами 2 и 3 не превышало 200 мкм, между 3 и 4 — около 10 мм. Температуру горячего конца определяли по сопротивлению терморезистивной ветви.

Проведена серия измерений на кристаллах твердого раствора SiGe с концентрацией примеси бора, обеспечивающей близость к переходу "металл—изолятор" с диэлектрической стороны перехода.

На рис. 2 представлены температурные зависимости сопротивления кристаллов с удельным сопротивлением ρ =0,016 Ом·см на различных подложках. Из рисунка видно, что сопротивление НК, деформированного сжатием до уровня $\varepsilon = -3,8\cdot10^{-3}$ отн. ед., изменяется приблизительно на три порядка в интервале температур 4,5—50 К. Кроме того, в этой области температур наблюдается зависимость R(T), близкая к линейной.

Для недеформированных НК с низким уровнем легирования (ρ =0,025 Ом·см) наблюдалось такое же резкое изменение сопротивления, однако степень нелинейности зависимости R(T) была значительно больше.

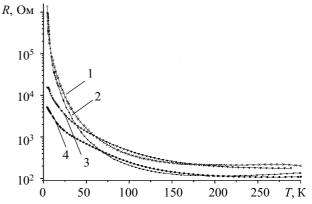


Рис. 2. Температурные зависимости сопротивления НК Si–Ge (ρ =0,016 Ом·см) на различных подложках: I — Al, ε =-4,3·10⁻³; 2 — Cu, ε =-3,8·10⁻³; 3 — кварц, ε =+4,7·10⁻⁴; 4 — без подложки, ε =0



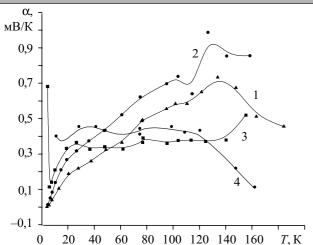


Рис. 3. Температурные зависимости коэффициента Зеебека НК Si–Ge на различных подложках: l — без подложки, ϵ =0; 2 — кварц, ϵ =+4, $7\cdot10^{-4}$; 3 — Cu, ϵ =3, $8\cdot10^{-3}$; 4 — Al, ϵ =-4, $3\cdot10^{-3}$ (l—3 — ρ =0,016, x=0,03; 4 — ρ =0,025, x=0,05)

На рис. 3 представлены температурные зависимости коэффициента Зеебека α для различных образцов НК. Как видно из рисунка, деформация растяжения (кривая 2) несущественно влияет на температурный ход коэффициента Зеебека. В то же время деформация сжатия (кривая 3) приводит к принципиальному изменению характера зависимости $\alpha(T)$ — появляется температурный интервал (20—100 K), в котором значение α достаточно стабильно.

С физической точки зрения наличие максимума α на температурной зависимости в недеформированных образцах объясняется эффектом фононного увлечения носителей заряда. Деформация растяжения несколько увеличивает этот эффект, что приводит к возрастанию абсолютной величины максимума α . Деформация сжатия, по-видимому, способствует подавлению эффекта фононного увлечения, что может быть следствием изменения фононного спектра деформированного кристалла.

Из представленных в **таблице** сравнительных термометрических характеристик HK Si—Ge видны преимущества использования деформированных кристаллов по сравнению с недеформированными: существенно расширяется диапазон рабочих температур и повышается температурная чувствительность терморезистора.

	-		• •
Образцы	Темпера- турный интервал, К	Температурный коэффициент сопротивления, %/K	Температурная чувствительность при <i>T</i> =7 K, Ом/K
Недеформированный	4,210	1316	300
Деформированный, $\varepsilon = -3.8 \ 10^{-3}$ отн. ед.	4,250	616	12500

С целью оптимизации параметров датчика (повышения чувствительности, расширения области рабочих температур) были проведены измерения температурного хода коэффициента Зеебека для образцов различного состава (x=0,01...0,05) и разной степени сжатия (ϵ = $-3,8\cdot10^{-3}$... $-4,3\cdot10^{-3}$). Установлено, что твердые растворы $\mathrm{Si}_{1-x}\mathrm{Ge}_x$, имеющие состав x=0,03...0,05, наиболее чувствительны к деформации, т. к. их коэффициент тензочувствительности максимален.

Практически для всех исследованных образцов получена удовлетворительная стабильность коэффици-

ента Зеебека в температурном интервале 20—100 К. Однако максимальная величина $\alpha = 0,47\pm0,02$ мВ/К получена для образцов, имеющих состав x=0,05 ($\rho=0,025$ Ом·см) при уровне деформации $\epsilon=-4,3\cdot10^{-3}$ на подложке из Al (кривая 4 на рис. 3).

Таким образом, установлено, что деформация существенно влияет на термометрические характеристики кристаллов. Анализ полученных результатов позволяет говорить о том, что специально деформированные НК Si—Ge могут быть эффективно использованы в датчиках для измерения криогенных температур. Причем использование НК состава x=0,03 (p=0,16 Ом·см) обеспечивает наилучшие параметры терморезистивной ветви, а состава x=0,05 (p=0,025 Ом·см) — термоэлектрической. Поскольку, по мнению авторов, для предлагаемого датчика более важными являются термоэлектрические характеристики, в качестве термочувствительного элемента был применен кристалл с x=0,05.

Датчик представляет собой НК Si_{1_x}Ge_x диаметром 40 мкм с четырьмя платиновыми выводами диаметром 30 мкм (см. рис. 1), приклеенный с помощью клея ВЛ-931 на алюминиевую подложку. Между контактами 1 и 2 измеряется сопротивление терморезистивной ветви и по термометрическим характеристикам (рис. 2) определяется абсолютная температура горячего конца (в диапазоне 4,2—120 К). Между контактами 3 и 4 измеряется термо-эдс, которая позволяет определить разность температур между горячим и холодным концами кристалла. Диапазон рабочих температур термоэлемента (а соответственно, и самого датчика) 20— 120 К. Точность измерения абсолютной температуры составляет 0,2 К, разности температур — 0,1 К. Инерционность датчика при измерении температуры составляла не более 60 мс.

Так как длина терморезистивной ветви составляет 200—300 мкм, а диаметр кристалла 40 мкм, то предложенный датчик может служить термозондом для исследования распределения температуры на поверхности материалов.

Исследования также показали, что магнитное поле (вплоть до полей с магнитной индукцией 14 Тл) практически не влияет на величину и характер температурной зависимости коэффициента Зеебека и сопротивления кристаллов.

Таким образом, полученные результаты показали, что деформированные сжатием нитевидные кристаллы твердых растворов $\mathrm{Si}_{1-x}\mathrm{Ge}_x$ (x=0,05) можно успешно использовать в датчиках для измерения криогенных температур, работоспособных в условиях действия сильных магнитных полей.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

- 1. Андреев А. Г., Забродский А. Г., Звягин И. П., Егоров С. В. Термоэдс нейтронно-легированого Ge:Ga в области прыжковой проводимости // ФТП.— 1997.— Т. 31, № 10.— С. 1174—1179.
- 2. Лончаков А. Т., Цидилковский А. М., Матвеев Г. А. Термо-эдс *n*-Ge вблизи перехода металл-диэлектрик // ФТП.—1988.— Т. 22, № 5.— С. 839—842.
- 3. Van Herwaarden A. W., Sarro P. M. Thermal sensors based on the Seebeck effect // Sensors and Actuators.— 1986.— Vol. 10.— P. 321.
- 4. Дружинін А. О., Островський І. П., Лях Н. С., Матвієнко С. М. Деформаційно-стимульовані ефекти у ниткоподібних кристалах твердого розчину Ge-Si // Вісник НУ "Львівська політехніка". Сер. "Електроніка".— 2003.— № 482.— С.105—111.